METHOD FOR PRODUCING OPTICALLY ACTIVE TRIHALOANILINO DERIVATIVE, AND OPTICALLY ACTIVE PHOSPHINE LIGAND

Patent number:

JP2002363143

Publication date:

2002-12-18

Inventor:

SATO KOJI; KOBAYASHI YUKINARI

Applicant:

DAI ICHI SEIYAKU CO LTD

Classification:

- international:

C07C213/02; B01J31/24; C07C215/08; C07D323/00;

C07F19/00

- european:

Application number: JP20010167895 20010604

Priority number(s):

Report a data error here

Abstract of JP2002363143

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for efficiently producing an optically active trihaloanilino derivative useful for the production of an antimicrobial compound by an asymmetric reduction, and further to provide an optically active phosphine ligand usable for the production method. SOLUTION: This method for producing the optically active trihaloanilino derivative in a short step in high efficiency comprises treating a mixture comprising a trihaloaniline, 3-hydroxy-2-propanone or a compound obtained by protecting the hydroxy group thereof, a group VIII transition metal complex, and the optically active phosphine ligand, in a hydrogen gas atmosphere, or treating a mixture comprising the trihaloaniline, the 3-hydroxy-2-propanone or the compound obtained by protecting the hydroxy group thereof, in the presence of a catalyst prepared from the group VIII transition metal complex and the optically active phosphine ligand, in the hydrogen gas atmosphere. The optically active phosphine ligand suitable for the production method is also provided.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-363143 (P2002-363143A)

(43)公開日 平成14年12月18日(2002.12.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)	
C 0 7 C 213/02		C 0 7 C 213/02	4 C 0 2 2	
B01J 31/24		B01J 31/24	Z 4G069	
C 0 7 C 215/08		C 0 7 C 215/08	4H006	
C 0 7 D 323/00		C 0 7 D 323/00	4H039	
CO7F 19/00		C 0 7 F 19/00	4H050	
	審査請求	未請求 請求項の数27 〇	L (全 27 頁) 最終頁に続く	
(21)出願番号	特顧2001-167895(P2001-167895)	(71)出顧人 000002831		
		第一製薬材	式会社	
(22)出顧日	平成13年6月4日(2001.6.4)	東京都中央区日本橋3丁目14番10号		
	·	(72)発明者 佐藤 耕豆	•	
		東京都江戸	川区北葛西1丁目16番13号 第	
		一製薬株式	会社東京研究開発センター内	
		(72)発明者 小林 幸業		
		東京都江戸	· 「川区北葛西1丁目16番13号 第	
		1	会社東京研究開発センター内	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 光学活性トリハロアニリノ誘導体の製造方法および光学活性ホスフィン配位子

(57)【要約】

【課題】 抗菌性化合物の製造に有用な光学活性トリハロアニリン誘導体を不斉還元反応により効率的に製造する方法と、該製造方法に使用する光学活性なホスフィン配位子を提供すること。

【解決手段】 トリハロアニリン、3-ヒドロキシー2ープロパノンもしくはその水酸基を保護した化合物、第VIII 族遷移金属錯体、および光学活性ホスフィン配位子を含む混合物を水素ガス雰囲気下で処理することにより、またはトリハロアニリン、3-ヒドロキシー2ープロパノンもしくはその水酸基を保護した化合物を含む混合物を第VIII族遷移金属錯体と光学活性ホスフィン配位子とから調製される触媒存在下で水素ガス雰囲気下で処理することにより、光学活性トリハロアニリノ誘導体を短工程かつ高収率で製造する方法、および本製造方法に適した光学活性ホスフィン配位子。

*

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 次式

【化1】

$$X^3$$
 X^2
 NH_2
 (I)

(式中、X¹、X²、およびX³は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される化合物、次式【化2】

(式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物、第VIII族遷移金属錯体、および光学活性ホスフィン配位子を含む混合物を、水素ガス雰囲気下において処理することを特徴とする次式【化3】

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される光学活性化合物の製造方法。

【請求項3】 次式

[化7]

$$X^3$$
 X^2
 NH_2
 (I)

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される化合物および次式【化8】

(式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物を含む混合物を、第VIII族 50

* (式中、X¹、X²、およびX³は、各々独立して、ハロゲン原子を意味し、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物のうちの光学活性化合物の製造方法。

【請求項2】 次式

【化4】

$$X^3$$
 X^2
 NH_2
 X^1

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される化合物、次式 【化5】

(式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味す 20 る。)で表される化合物、第VIII族遷移金属錯体、 および光学活性ホスフィン配位子を含む混合物を、水素 ガス雰囲気下において処理することを特徴とする次式 【化6】

(IIIa)

遷移金属錯体と光学活性ホスフィン配位子とから調製される触媒の存在下、水素ガス雰囲気下において処理する ことを特徴とする次式

[化9]

40

$$X^3$$
 X^2
 NH
 X^1
 $Me * CH2OR$
(III)

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味し、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物のうちの光学活性化合物の製造方法。

【請求項4】 次式 【化10】

 X^3 X^2 NH_2 (I)

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される化合物および次式【化11】

* (式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物を含む混合物を、第VIII族 選移金属錯体と光学活性ホスフィン配位子とから調製される触媒の存在下、水素ガス雰囲気下において処理する ことを特徴とする次式

【化12】

X' CHOR

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハ 3 ロゲン原子を意味する。)で表される光学活性化合物の 20 製造方法。

【請求項5】 光学活性ホスフィン配位子が、フェロセニル構造を有する配位子である請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項6】 光学活性ホスフィン配位子が、次式 【化13】

$$\begin{array}{c}
R^{a} \\
H \\
 & * Q \\
Fe PR^{b}_{2}
\end{array}$$
(IVa)

※または次式 20 【化14】

$$\begin{array}{ccc}
& PR^{b}{}_{2}R^{a} \\
& & + Q
\end{array}$$
Fe (IVb)

(IIIa)

(式IVaまたは式IVb中、R*はアルキル基または 置換基を有していてもよいアリール基を意味し、R*は アルキル基または置換基を有していてもよいアリール基 30 を意味し、Qは下記の基の群から選ばれるいずれか一の 基を意味する。)

(化15) -N-R°

ここで、R°はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換シリル基、または−CH₂OR¹を意味し、R¹は 40アルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。R⁴およびR°は、各々独立して、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。)で表される配位子である請求項5に記載の製造方法。

【請求項7】 光学活性ホスフィン配位子が次式 【化16】

(式中、R[®] はアルキル基または置換基を有していてもよいアリール基を意味し、R[®] はアルキル基または置換基を有していてもよいアリール基を意味し、Qは下記の基の群から選ばれるいずれか一の基を意味する。

【化17】

ここで、R°はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換シリル基、または−CH₂OR¹を意味し、R¹はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。R⁴およびR°は、各々独立して、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。)で表される配位子である請求項5に記載の製造方法。

【請求項8】 Qが下記の基である請求項6または請求項7に記載の製造方法。

【化18】

(式中、R⁴ は、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。)

【請求項9】 R⁴ が、置換基を有していてもよい炭素数1から30の直鎖もしくは分枝アルキル基、炭素数3から12の環状アルキル基、または芳香環部分がベンゼン環であるアラルキル基である請求項8に記載の製造方法。 *30

$$[ML_k Y_1]_m Z_n$$

(式中、Mは第VIII族遷移金属を意味し、Lは有機配位子を意味し、Yは水素原子、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシ基、またはヒドロキシ基を意味し、Zはカウンターイオンを意味する。k および1は各々0から6の整数を意味し、mは1または2の整数を意味し、nは0または1の整数を意味する。)で表される錯体である請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項15】 Mが、イリジウム、ロジウム、または 40 ルテニウムである請求項14に記載の製造方法。

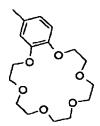
【請求項16】 Mがイリジウムである請求項14に記載の製造方法。

【請求項17】 第VIII族遷移金属錯体が、次式 [Ir(COD)C1]₂ (VI)

(式中、CODは1、5-シクロオクタジエンを意味する。)で表されるイリジウム錯体である請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項18】 Rが水素原子である請求項1から請求項17のいずれか1項に記載の製造方法。

*【請求項10】 R⁴ が、エチル基、ジシクロヘキシルメチル基、イソプロピル基、第三級ブチル基、1-プロピルブチル基、1-デシルウンデシル基、1-テトラデシルベンタデシル基、1、1-ジメチルベンチル基、シロプロピル基、シクロブチル基、シクロベンチル基、シクロヘキシル基、シクロウンデシル基、トリシクロ
[3.3.1.1³ ¹] デカン-3-イル基、フェニル基、ジフェニルメチル基、または次式 【化19】



で表される基である請求項8に記載の製造方法。

【請求項 1 1 】 R ⁴ が 1 − プロビルブチル基である請求項 8 に記載の製造方法。

【請求項12】 R* がメチル基である請求項6から請求項11のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項13】 R^b がフェニル基である請求項6から 請求項12のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項14】 第VIII族遷移金属錯体が、次式 (V)

【請求項19】 X^1 、 X^2 、および X^8 がフッ素原子である請求項1から請求項18のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項20】 次式

[化20]

または次式 【化21】

(IVb')

7

(式IVaまたは式IVb中、R°はアルキル基または 置換基を有していてもよいアリール基を意味し、R°は アルキル基または置換基を有していてもよいアリール基* *を意味し、Qは下記の基の群から選ばれるいずれか一の 基を意味する。

[化22]

$$-0 - R^{\circ}, \qquad R^{d}, \quad R^{d} + R^{\circ}$$

10

ことで、R°はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換シリル基、または-CH2OR1を意味し、R¹はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。R°およびR°は、各々独立して、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。)で表される光学活性ホスフィン配位子。

【請求項21】 次式

【化23】

$$-0 - R^{\circ}, \qquad R^{d}, \Rightarrow \mathcal{U} \stackrel{\mathsf{N}}{\mapsto} R^{\mathsf{N}}$$

ここで、R®はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換シリル基、または一CH®OR®を意味し、R®はなアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。R®およびR®は、各々独立して、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。)で表される光学活性ホスフィン配位子。【請求項22】 Qが下記の基である請求項20または請求項21に記載の光学活性ホスフィン配位子。

【化25】

【請求項23】 R⁴ が、置換基を有していてもよい炭素数1から30の直鎖もしくは分枝アルキル基、炭素数3から12の環状アルキル基、または芳香環部分がベンゼン環であるアラルキル基である請求項22に記載の光学活性ホスフィン配位子。

【請求項24】 R⁴が、エチル基、ジシクロヘキシルメチル基、イソプロビル基、第三級ブチル基、1-プロビルブチル基、1-デシルウンデシル基、1-テトラデシルペンタデシル基、1,1-ジメチルペンチル基、シクロプロビル基、シクロブチル基、シクロペンチル基

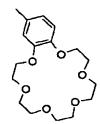
シクロヘキシル基、シクロウンデシル基、トリシクロ $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 & 1^{3} & {}^{1} \end{bmatrix}$ デカン $\begin{bmatrix} 3 & -1 & -3 & -1 \end{bmatrix}$ ル基、ジフェニルメチル基、または次式

(式中、R* はアルキル基または置換基を有していても

よいアリール基を意味し、Aはアルキル基または置換基 を有していてもよいアリール基を意味し、Qは下記の基

の群から選ばれるいずれか一の基を意味する。

[作26]



で表される基である請求項22に記載の光学活性ホスフィン配位子。

【請求項25】 R⁴ が1-プロピルブチル基である請40 求項22に記載の光学活性ホスフィン配位子。

【請求項26】 R* がメチル基である請求項20から 請求項25のいずれか1項に記載の光学活性ホスフィン 配位子。

【請求項27】 R^b がフェニル基である請求項20から請求項26のいずれか1項に記載の光学活性ホスフィン配位子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

シルペンタデシル基、1,1-ジメチルペンチル基、シ 【産業上の利用分野】 本発明は、抗菌性化合物の製造 クロプロビル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、 50 に有用な光学活性なトリハロアニリン誘導体の製造方法 とその製造方法に使用する光学活性なホスフィン配位子 に関する。

[0002]

【従来の技術】S-(-)-9-フルオロ-3-メチル -10-(4-メチル-1-ピペラジニル)-7-オキ ソ-2,3-ジヒドロ-7H-ピリド[1,2,3-d*

* e] [1, 4] ベンゾオキサジン-6-カルボン酸(レボフロキサシン、LVFX;特開昭62-252790 号公報)は優れた合成抗菌剤として知られている。この合成抗菌剤の製造中間体として式 [化27]

(IIIa)

(式中、X¹、X²、およびX³は、各々独立して、ハロゲン原子を意味し、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物(以下、化合物(IIIa)と表し、他の番号で表される化合物も同様に表※

※す。)は有用であり、下記の製法にて製造可能なことが 知られている(WO01/18005)。 【化28】

【0003】すなわち、化合物(IIIa)は、トリハロニトロベンゼン(A)を出発物質として2ートリハロアニリノプロピオン酸(C)を得て、これを(R)ーフェニルエチルアミンで光学分割し、さらに数工程を経て得られるものである。しかしながら、この製造方法では必要とする光学異性体の収率が理論上最高でも50%であって光学活性な化合物を得る方法としては必ずしも効率的でなく、また、不要な光学異性体を活用するためには光学異性体の転換反応を実施する必要があった。このように、従来の製造方法はさらに改良すべき問題占があ

った。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の問題 点を解決し、抗菌性化合物の製造に有用な光学活性トリ ハロアニリノ誘導体を不斉還元反応により効率的に製造 する方法と、該製造方法に使用する光学活性なホスフィ ン配位子を提供することを目的とする。

[0005]

は光学異性体の転換反応を実施する必要があった。この 【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意検討したように、従来の製造方法はさらに改良すべき問題点があ 50 結果、トリハロアニリン、3-ヒドロキシ-2-プロバ

ノンもしくはその水酸基を保護した化合物、第VIII 族遷移金属錯体、および光学活性ホスフィン配位子を含む混合物を水素ガス雰囲気下で処理することにより、またはトリハロアニリン、3-ヒドロキシ-2-プロバノンもしくはその水酸基を保護した化合物を含む混合物を第VIII族遷移金属錯体と光学活性ホスフィン配位子とから調製される触媒存在下で水素ガス雰囲気下で処理することにより、光学活性トリハロアニリノ誘導体を短工程かつ高収率で製造できることを見出し、さらに本製造方法に適した光学活性ホスフィン配位子を見出して本 10 発明を完成した。

【0006】すなわち、本発明は、次式 【化29】

$$X^3$$
 X^2
 NH_2
 (I)

(式中、X¹、X²、およびX³は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される化合物、次式【化30】

(式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物、第VIII族遷移金属錯体、および光学活性ホスフィン配位子を含む混合物を、水素ガス雰囲気下において処理することを特徴とする次式 *

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される光学活性化合物の 製造方法:次式

【化35】

$$X^{2} \longrightarrow NH_{2}$$
 (I)

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される化合物および次式【化36】

* (化31)

12

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味し、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物のうちの光学活性化合物の製造方法;次式

[化32]

$$X^3$$
 X^2
 NH_2
 (I)

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。)で表される化合物、次式 【化33】

(式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物、第VIII族遷移金属錯体、および光学活性ホスフィン配位子を含む混合物を、水素ガス雰囲気下において処理することを特徴とする次式【化34】

(IIIa)

10 (式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物を含む混合物を、第VIII族 選移金属錯体と光学活性ホスフィン配位子とから調製される触媒の存在下、水素ガス雰囲気下において処理する ことを特徴とする次式

[化37]

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味し、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物のうちの光学活性化合物の製造方法;次式

[化38]

$$X^3$$
 X^2
 X^1
 NH_2
(I)

(式中、 X^1 、 X^2 、および X^3 は、各々独立して、ハロゲン原子を意味する。) で表される化合物および次式*

*【化39】

(式中、Rは水素原子または水酸基の保護基を意味する。)で表される化合物を含む混合物を、第VIII族 選移金属錯体と光学活性ホスフィン配位子とから調製される触媒の存在下、水素ガス雰囲気下において処理する 10 ことを特徴とする次式

【化40】

(IIIa)

(式中、X¹、X²、およびX³は、各々独立して、ハ ミロゲン原子を意味する。)で表される光学活性化合物の 20 製造方法;光学活性ホスフィン配位子が、フェロセニル 構造を有する配位子である上記の製造方法;光学活性ホスフィン配位子が、次式

【化41】

$$\begin{array}{c}
R^{a} \\
H \\
 & \times Q \\
Fe & PR^{b}_{2}
\end{array}$$
(IVa)

または次式

(式IVaまたは式IVb中、R*はアルキル基または 置換基を有していてもよいアリール基を意味し、R*は アルキル基または置換基を有していてもよいアリール基 を意味し、Qは下記の基の群から選ばれるいずれか一の 30 基を意味する。

30 茶で、尽味 9

-O-R° -O-R^d

【化43】

ここで、R°はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換シリル基、または−CH₂OR¹を意味し、R¹はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ま 40 たは置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。R⁴およびR°は、各々独立して、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。)で表される配位子である上記の製造方法:光学活性ホスフィン配位子が次式

【化44】

(式中、R*はアルキル基または置換基を有していてもよいアリール基を意味し、R*はアルキル基または置換基を有していてもよいアリール基を意味し、Qは下記の基の群から選ばれるいずれか一の基を意味する。

【化45】

CCで、R°はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換シリル基、または−CH₂OR¹を意味し、R¹はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。R⁴およびR°は、各々独立して、置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアリール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意味する。)で表される配位子である上記の製造方法;Qが下記の基である上記の製造方法;

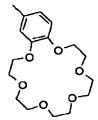
【化46】

(式中、Mは第VIII族遷移金属を意味し、Lは有機配位子を意味し、Yは水素原子、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシ基、またはヒドロキシ基を意味し、Zはカウンターイオンを意味する。kおよび1は各 30々0から6の整数を意味し、mは1または2の整数を意味し、nは0または1の整数を意味する。)で表される錯体である上記の製造方法; Mが、イリジウム、ロジウム、またはルテニウムである上記の製造方法; 第VIII族遷移金属錯体が、次式

 $[lr(COD)Cl]_{2} \qquad (VI)$

(式中、CODは1, 5-シクロオクタジエンを意味する。)で表されるイリジウム錯体である上記の製造方法; Rが水素原子である上記の製造方法; X¹、X²、およびX³がフッ素原子である上記の製造方法; 次式 【化48】

*ル基、1-プロビルブチル基、1-デシルウンデシル基、1-テトラデシルペンタデシル基、1,1-ジメチルペンチル基、シクロプロビル基、シクロブチル基、シクロウンデシル10 基、トリシクロ[3.3.1.1^{3.1}] デカン-3-イル基、フェニル基、ジフェニルメチル基、または次式【化47】



で表される基である上記の製造方法; R ⁶ が 1 - プロビ ルブチル基である上記の製造方法; R ⁸ がメチル基であ る上記の製造方法; R ⁶ がフェニル基である上記の製造

方法;第VIII族遷移金属錯体が、次式

(V) または次式 (化49) PR^b2R^aH ・*Q Fe (IVb)

(式IVaまたは式IVb中、R®はアルキル基または 置換基を有していてもよいアリール基を意味し、R®は アルキル基または置換基を有していてもよいアリール基 を意味し、Qは下記の基の群から選ばれるいずれか一の 基を意味する。

40 【化50】

$$-0 - R^{c}, \qquad R^{d}, \quad 33.5 \text{ W} \qquad H$$

ここで、R°はアルキル基、置換基を有していてもよい アリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、 置換シリル基、または-CH2 OR1 を意味し、R1 は アルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ま たは置換基を有していてもよいアラルキル基を意味す る。R⁴ およびR⁶ は、各々独立して、置換基を有して いてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリ ール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基 を意味する。)で表される光学活性ホスフィン配位子; 次式

【化51】

$$-0-R^{\circ}$$

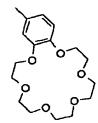
ここで、R^b はアルキル基、置換基を有していてもよい アリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、 置換シリル基、または-CH2OR1を意味し、R1は アルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ま たは置換基を有していてもよいアラルキル基を意味す る。R° およびR⁴ は、各々独立して、置換基を有して いてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリ ール基、または置換基を有していてもよいアラルキル基 を意味する。)で表される光学活性ホスフィン配位子; 30 Qが下記の基である上記の光学活性ホスフィン配位子; 【化53】

R⁴ が、置換基を有していてもよい炭素数1から30の 直鎖もしくは分枝アルキル基、炭素数3から12の環状 アルキル基、または芳香環部分がベンゼン環であるアラ ルキル基である上記の光学活性ホスフィン配位子;R⁴ 40 【発明の実施の形態】本発明は、化合物(I)、化合物 が、エチル基、ジシクロヘキシルメチル基、イソプロピ ル基、第三級ブチル基、1-プロピルブチル基、1-デ シルウンデシル基、1-テトラデシルペンタデシル基、 1, 1-ジメチルペンチル基、シクロプロピル基、シク ロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シ

(式中、R* はアルキル基または置換基を有していても よいアリール基を意味し、Aはアルキル基または置換基 を有していてもよいアリール基を意味し、Qは下記の基 の群から選ばれるいずれか一の基を意味する。

クロウンデシル基、トリシクロ[3.3.1. 13・7] デカン-3-イル基、フェニル基、ジフェニ ルメチル基、または次式

【化54】



で表される基である上記の光学活性ホスフィン配位子; R⁴ が1-プロピルブチル基である上記の光学活性ホス フィン配位子; R* がメチル基である上記の光学活性ホ スフィン配位子: Rb がフェニル基である上記の光学活 性ホスフィン配位子;等に関する。

[0007]

(II)、第VIII族遷移金属錯体([ML, Y,] **』** Z 。)、および光学活性ホスフィン配位子を含む混合 物を水素ガス雰囲気下で処理して光学活性なトリハロア ニリノ誘導体(III)に導くものである。

【化55】

$$X^{3}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{2}$$

$$X^{1}$$

$$Y^{2}$$

$$Y^{2$$

【0008】反応工程中の置換基について説明する。 【0009】X¹、X²、およびX³は、各々独立し て、ハロゲン原子を意味し、ハロゲン原子としてはフッ 素原子、塩素原子、臭素原子、またはヨウ素原子が挙げ られるが、これらのうちではフッ素原子が好ましい。 【0010】Rは、水素原子または水酸基の保護基を意 味するが、水酸基の保護基としては特に限定されず、置 換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有してい てもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラル キル基、置換基を有していてもよいアシル基、または置 換シリル基等を挙げることができる。置換基を有してい てもよいアルキル基としては、例えば、メチル基、エチ ル基、メトキシメチル基、メトキシエチル基等を挙げる ことができる。置換基を有していてもよいアリール基と しては、例えば、フェニル基、ジメトキシフェニル基、 p-メトキシフェニル基等を挙げることができる。置換 基を有していてもよいアラルキル基としては、例えば、 α-フェニルエチル基、ベンジル基、ニトロベンジル 基、トリチル基、トルイル基等を挙げることができる。 置換基を有していてもよいアシル基としては、例えば、 アセチル基、メトキシアセチル基、トリフルオロアセチ 30 ル基、クロロアセチル基、ピバロイル基、ホルミル基、 ベンゾイル基、p-メトキシベンジル基、p-ニトロベ ンゾイル基等を挙げることができる。置換シリル基とし ては、例えば、トリメチルシリル基、イソプロピルジメ チルシリル基、第三級ブチルジメチルシリル基、トリベ ンジルシリル基、第三級ブチルジフェニルシリル基等が 挙げられる。Rとしては、水素原子、トリチル基、ベン ジル基、ベンゾイル基、または第三級ブチルジメチルシ

【0011】本発明の製造方法に使用する光学活性なホ 40 スフィン配位子は、高収率と高い光学純度を達成できるものであれば特に限定されない。例えば、文献等で報告されているものとしては、S-またはR-2,2'ービス(ジフェニルホスフィノ)ー1,1'ービナフチル: BINAP、S-またはR-2,2'ービス(ジーpートリルホスフィノ)ー1,1'ービナフチル:tolーBINAP、2S,4S-または2R,4R-N-(tert-ブトキシカルボニル)ー4-(ジフェニルホスフィノ)ー2-[(ジフェニルホスフィノ)メチル]ピロリジン:BPPM、2S,3S-または2R,3R-50

リル基が好ましく、さらに水素原子が好ましい。

10 2, 3-0-イソプロピリデン-2, 3-ジハイドロキ シー1, 4-ビス (ジフェニルホスフィノ) ブタン:D IOP、4S, 5S-または4R, 5R-4, 5-ビス [ビス(3', 5' -ジメチル-4' -メトキシフェニ ル) ホスフィノメチル] -2, 2-ジメチル-1, 3-ジオキソラン: MOD-DIOP、2S, 3S-または 2R, 3R-2, 3-ビス (ジフェニルホスフィノ) ブ タン: CHIRAPHOS、2S, 4S-または2R, 4R-2, 4-ビス (ジフェニルホスフィノ) ペンタ ン: BDPP、5S, 6S-または5R, 6R-5, 6 - ビス (ジフェニルホスフィノ) ノルボルネン: NOR PHOS、R-1-[S-1', 2-ビス(ジフェニル ホスフィノ) フェロセニル] エチルアルコールまたはそ の立体異性体: BPPFOH、R-1-[S-1', 2 -ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル アセタートまたはその立体異性体: BPPFOAc、S -1-[R-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセニ ル] エチルジシクロヘキシルホスフィンまたはその立体 異性体: JOIPHOS、1、2-ビス「(2R、5) R) - 2, $5 - \Im x + \Im x + \Im x - \Im x - \Im x + \Im x - 3$ 立体異性体: Et-BPE、1, 2-ビス[(2S, 5 R) -2, 5-ジエチルホスフォラノ] ベンゼンまたは その立体異性体:Et-DUPHOS等が挙げられる が、これらの既知の光学活性ホスフィンの中では、フェ ロセニル構造を持ったBPPFOAcが好ましい。

【0012】本発明者は鋭意検討の結果、本発明の製造 方法にはフェロセニル構造を持つ光学活性ホスフィンの うちでも次式の構造を持つものがさらに好ましいことを 見出した。

【化56】

または次式 【化57】

$$\begin{array}{ccc}
& PR^{b}{}_{2}R^{a} \\
& & PR^{b}{}_{2}R^{a}
\end{array}$$
(IVb)

これらのうちでも、さらに次式に示す立体配置を有する ものが好ましい。

【化58】

【0013】CCで、Cれらの配位子(IVa)、(I Vb)、および(IVb')は、発明者の独創により着 想され合成された新規物質である。これらの配位子に関 する置換基の説明をする。

【0014】R。はアルキル基または置換基を有してい 20 てもよいアリール基を意味するが、R* におけるアルキ ル基としては、炭素数1から6の直鎖もしくは分枝鎖ア*

$$-0-R^{\circ}$$

【0017】R°はアルキル基、置換基を有していても よいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル 1 はアルキル基、置換基を有していてもよいアリール 基、または置換基を有していてもよいアラルキル基を意 味する。R°におけるアルキル基としては、炭素数1か ら6の直鎖もしくは分枝鎖アルキル基、または炭素数3 から8の環状アルキル基が挙げられ、これらのうちでは エチル基が好ましい。R°におけるアリール基として は、フェニル基が挙げられ、芳香環上には炭素数1から 3の直鎖もしくは分枝鎖アルキル基、アルコキシ基、ニ トロ基、ハロゲン原子、またはスルホニル基等が1個か は同一でも異なっていてもよい。R°におけるアラルキ ル基としては、ベンジル基、ジフェニルメチル基、また はトリフェニルメチル基等が挙げられ、芳香環上には炭 素数1から3の直鎖もしくは分枝鎖アルキル基、アルコ キシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、またはスルホニル基 等が1個から3個置換していてもよく、これらの芳香環 への置換基は同一でも異なっていてもよいが、これらの うちではベンジル基、ジフェニルメチル基、またはトリ フェニルメチル基が好ましい。R°におけるシリル基と *ルキル基、または炭素数3から8の環状アルキル基が挙 げられ、これらのうちではメチル基が好ましい。また、 R* におけるアリール基としては、フェニル基が挙げら れ、芳香環上には炭素数1から3の直鎖もしくは分枝鎖 アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、 またはスルホニル基等が1個から3個置換していてもよ く、これらの芳香環への置換基は同一でも異なっていて もよい。

【0015】Rbはアルキル基または置換基を有してい 10 てもよいアリール基を意味するが、Rb におけるアルキ ル基としては、炭素数1から6の直鎖もしくは分枝鎖ア ルキル基、または炭素数3から8の環状アルキル基が挙 げられる。また、R^b におけるアリール基としては、フ ェニル基が挙げられ、芳香環上には炭素数1から3の直 鎖もしくは分枝鎖アルキル基、アルコキシ基、ニトロ 基、ハロゲン原子、またはスルホニル基等が1個から3 個置換していてもよく、これらの芳香環への置換基は同 一でも異なっていてもよいが、これらのうちではフェニ ル基が好ましい。

【0016】Qは下記の基の群から選ばれるいずれか一 の基を意味する。

【化59】

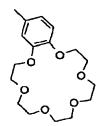
リイソプロピルシリル基、第三級ブチルジメチルシリル 基、または第三級ブチルジフェニルシリル基等が挙げら 基、置換シリル基、または−CH₂ OR′を意味し、R 30 れ、これらのうちでは第三級ブチルジメチルシリル基が 好ましい。R° における-CH₂ OR¹ のR¹ として は、炭素数1から6の直鎖もしくは分枝鎖アルキル基、 炭素数3から8の環状アルキル基、フェニル基、または アラルキル基等が挙げられ、これらのうちではアルキル 基が好ましく、さらにメチル基が好ましい。

【0018】R⁴ は置換基を有していてもよいアルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換 基を有していてもよいアラルキル基を意味する。R⁴ に おけるアルキル基としては、炭素数1から30の直鎖も ら3個置換していてもよく、これらの芳香環への置換基 40 しくは分枝鎖アルキル基、または炭素数3から12の環 状アルキル基が挙げられ、これらはハロゲン原子、また は炭素数3から12の環状アルキル基等が1個から3個 置換していてもよく、これらのアルキル基への置換基は 同一でも異なっていてもよい。これらのうちでは、エチ ル基、ジシクロヘキシルメチル基、イソプロピル基、第 三級ブチル基、1-プロピルブチル基、1-デシルウン デシル基、1-テトラデシルペンタデシル基、1,1-ジメチルベンチル基、シクロプロピル基、シクロブチル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、またはトリ しては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ト 50 シクロ[3.3.1.1°・7]デカン-3-イル基等

が好ましく、さらに1-プロピルブチル基が好ましい。 R⁴ におけるアリール基としては、フェニル基が挙げら れ、芳香環上には炭素数1から3の直鎖もしくは分枝鎖 アルキル基、アルコキシ基、ポリエーテル基、ニトロ 基、ハロゲン原子、またはスルホニル基等が1個から3 個置換していてもよく、これらの芳香環への置換基は同 一でも異なっていてもよく、また、置換基が2個の場合 にこれらが一緒になって環を形成してフェニル基に縮合 してもよいが、これらのうちではフェニル基、トリイソ プロピルフェニル基、または次式

23

【化60】



しては、ベンジル基、ジフェニルメチル基、トリフェニ ルメチル基が挙げられ、芳香環上には炭素数1から3の 直鎖もしくは分枝鎖アルキル基、アルコキシ基、ニトロ 基、ハロゲン原子、またはスルホニル基等が1個から3 個置換していてもよく、これらの芳香環への置換基は同 一でも異なっていてもよいが、これらのうちではベンジ ル基、ジフェニルメチル基、またはトリフェニルメチル 基が好ましい。

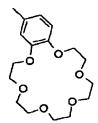
【0019】R°はアルキル基、置換基を有していても よいアリール基、または置換基を有していてもよいアラ 30 ルキル基を意味する。R°におけるアルキル基として は、炭素数1から30の直鎖もしくは分枝鎖アルキル 基、または炭素数3から12の環状アルキル基が挙げら れ、これらはハロゲン原子、または炭素数3から12の 環状アルキル基等が1個から3個置換していてもよく、 これらのアルキル基への置換基は同一でも異なっていて もよい。R°におけるアリール基としては、フェニル基 が挙げられ、芳香環上には炭素数1から3の直鎖もしく は分枝鎖アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、ハロゲ ン原子、またはスルホニル基等が1個から3個置換して 40 いてもよく、これらの芳香環への置換基は同一でも異な っていてもよい。R°におけるアラルキル基としては、*

*ベンジル基、ジフェニルメチル基、トリフェニルメチル 基が挙げられ、芳香環上には炭素数1から3の直鎖もし くは分枝鎖アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、ハロ ゲン原子、またはスルホニル基等が1個から3個置換し ていてもよく、これらの芳香環への置換基は同一でも異 なっていてもよい。

【0020】Qとしては、次式 【化61】

で表される基が好ましく、そのうちでもRoが、置換基 を有していてもよい炭素数1から30の直鎖もしくは分 枝アルキル基、炭素数3から12の環状アルキル基、ま たは芳香環部分がベンゼン環であるアラルキル基が好ま しく、さらにR⁴が、エチル基、ジシクロヘキシルメチ ル基、イソプロピル基、第三級ブチル基、1-プロピル ブチル基、1-デシルウンデシル基、1-テトラデシル で表される基が好ましい。R C におけるアラルキル基と 20 ベンタデシル基、1,1-ジメチルベンチル基、シクロ プロビル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シク ロヘキシル基、シクロウンデシル基、トリシクロ[3. 3. 1. 13. 7] デカン-3-イル基、フェニル基、 ジフェニルメチル基、または次式

【化62】



で表される基が好ましく、さらにR⁴が1-プロビルブ チル基であるのがより好ましい。

【0021】次に、式(IV)で表される光学活性配位 子の製造方法について説明する。なお、説明中の工程に はフォロセニル配位子の面不斉のうち一方についてしか 表記していないが、他方も同様に製造できる。

【0022】工程1 [化63]

(式中、R°、R°、およびR°は前記と同じ。Gはア ルキル金属を意味する。)

【0023】Qが-O-R°の場合、文献(T. Hayash i, et al., J. Org. Chem., 53, 113-120 (1988)) に記 載されている方法を適用できる(工程1)。すなわち、 アルコール (R°OH) 中で塩基の存在下、化合物 (V II)を反応させることにより配位子(VIII)を得 ることができる。用いる塩基としては、トリメチルアミ ン、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン、N,N-ジ イソプロピルエチルアミン、ピリジン、2,6-ルチジン、 1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン等のアミン類 が挙げられ、ピリジンが好ましい。反応温度は-78°Cか らアルコール(R°OH)の沸点の範囲で行うことがで き、室温からアルコール (R°OH) の沸点の範囲で行* * うのが好ましい。

【0024】また、文献 (T. Hayashi, et al., Bull. Chem. Soc. Jpn., 53, 1138-1151 (1980)) に記載され ている方法を適用できる。すなわち、置換基を有するア ルコラートR°OGの存在下、R°OHと反応させると とにより化合物(VIII)を得ることができる。Gと しては、リチウム、ナトリウム、またはカリウムが挙げ られ、ナトリウムが好ましい。反応温度は - 78℃からア ルコール(R°OH)の沸点の範囲で行うことができ、 10 室温からアルコール (R°OH) の沸点の範囲で行うの が好ましい。

【0025】工程2 【化64】

【0026】Qが-O-R° の場合の別法として、化 合物(IX)の水酸基に通常の保護基導入反応を行って 配位子(X)を得ることができる(工程2)。保護基導 入反応は、例えば、文献(T. W. Green, P. G. M. Wuts 編, Protective Groups in Organic Synthesis Third E dition, John Wiley & Sons, New York, 1999) に記載 されている方法を適用できる。本法を適用して、R°が シリル基の場合は、溶媒中で塩基の存在下、化合物(I X)をシリル化剤と反応させることで、配位子(X)を 得ることができる。シリル化剤としては、トリメチルシ リルクロリド、トリエチルシリルクロリド、トリイソブ ロビルシリルクロリド、第三級ブチルジメチルシリルク ロリド、第三級ブチルジフェニルシリルクロリド、トリ メチルシリルメタンスルホナート、トリエチルシリルト リフロオロメタンスルホナート、トリイソプロピルシリ ルトリフルオロメタンスルホナート、第三級ブチルジメ チルシリルトリフルオロメタンスルホナートが挙げら れ、第三級ブチルジメチルシリルクロリド、第三級ブチ ルジメチルシリルトリフルオロメタンスルホナートが好 ましい。用いる塩基としては、トリメチルアミン、トリ エチルアミン、ジイソプロピルアミン、N,N-ジイソプロ ピルエチルアミン、ピリジン、2,6-ルチジン、1,8-ジア ザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、イミダゾール、4-ジ メチルアミノビリジン等のアミン類が挙げられ、ビリジ ン、2,6-ルチジン、イミダゾール、4-ジメチルアミノビ リジンが好ましい。用いる溶媒は当該反応において、不 活性なものであれば特に制限はないが、ジエチルエーテ

系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、1,2-ジクロロ エタン等の塩素系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒、アセトニト リル、プロピオニトリル等のニトリル系溶媒が挙げら れ、ジクロロメタンが好ましい。反応温度は-78℃から 用いる溶媒の沸点の範囲で行うことができ、室温から溶 媒の沸点の範囲で行うのが好ましい。

【0027】また、R°が-CH₂OR¹の場合、溶媒 中で塩基の存在下、化合物(IX)を次式 R¹ OCH₂ X⁴

(式中、R は前記に同じであり、X はハロゲン原子を 示す。) で表される化合物と反応させることで配位子 (X)を得ることができる。Xとしては、フッ素、塩 素、臭素、またはヨウ素が挙げられるが、特に塩素、臭 素、またはヨウ素が好ましい。R¹OCH2X⁴として は、クロロメチルメチルエーテル、ベンジルクロロメチ ルエーテル、第三級ブチルクロロメチルエーテル等が挙 40 げられ、特にクロロメチルエーテルが好ましい。用いる 塩基としては、トリメチルアミン、トリエチルアミン、 ジイソプロピルアミン、N,N-ジイソプロピルエチルアミ ン、ピリジン、2,6-ルチジン、1,8-ジアザビシクロ[5. 4.0]-7-ウンデセン等のアミン類が挙げられ、特にN,N-ジイソプロピルエチルアミンが好ましい。用いる溶媒は 当該反応において、不活性なものであれば特に制限はな いが、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジ オキサン等のエーテル系溶媒、ジクロロメタン、クロロ ホルム、1,2-ジクロロエタン等の塩素系溶媒、アセトニ ル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル 50 トリル、プロピオニトリル等のニトリル系溶媒が挙げら

*

27

れ、ジクロロメタンまたはクロロホルムが好ましい。反 応温度は-78℃から用いる溶媒の沸点の範囲で行うこと ができ、室温から溶媒の沸点の範囲で行うのが好まし 64

【0028】工程3

【化65】

【0029】Qが次式 [1166]

$$(R^{d}C0)_{2}0$$

$$PR^{b}_{2}$$

$$R^{d}C0X^{5}$$

$$Fe PR^{b}_{2}$$

$$R^{d}C0_{2}H$$

$$(IX)$$

$$R^{d}C0_{2}D$$

$$Fe PR^{b}_{2}$$

$$(XII)$$

【0031】Qが次式 [化68]

で表される場合の別法として、化合物(IX)の水酸基 に通常の保護基導入反応を行って配位子(XII)を得 ることができる(工程4)。保護基導入反応は、例え ば、文献(T. W. Green, P. G. M. Wuts編, Protective Groups in OrganicSynthesis Third Edition, John Wi ley & Sons, New York, 1999) に記載されている方法を 適用できる。すなわち、溶媒中、塩基の存在下で酸無水 物((R⁴CO)₂O)または酸クロリド(R⁴COX '、X'はハロゲン原子を示す。)を化合物(IX)と反 40 ジシクロヘキシルカルボジイミド、1,3-ジイソプロビル 応させることで、配位子(XII)を得ることができ る。X'は塩素、臭素、ヨウ素原子等が挙げられるが、 塩素、臭素原子が好ましい。用いられる塩基としては、 トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピル アミン、N,N-ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、 2,6-ルチジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセ ン、4-ジメチルアミノビリジン等のアミン類が挙げられ るが、これらの塩基は2種以上の組み合わせであっても よい。これらのうちではトリエチルアミン、4ジメチル

で表される場合は、文献(T. Hayashi, et al., Bull. Chem. Soc. Jpn. 1980,53, 1138-1151) に記載されてい る方法を適用することができる(工程3)。すなわち、 化合物(XI)に酸無水物((R CO)2O)を反応 させることにより配位子(XII)を得ることができ 10 る。反応温度は - 78℃から酸無水物 ((R CO) 2 〇) の沸点の範囲で行うことができ、室温から酸無水 物 ((R CO)₂O)の沸点の範囲で行うのが好まし

【0030】工程4 [化67]

いて、不活性なものであれば特に制限はないが、ジエチ ルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等の エーテル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン等の塩素系溶媒、アセトニトリル、プロ 30 ピオニトリル等のニトリル系溶媒、N,N-ジメチルホルム アミド、N,N-ジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒、 酢酸メチル、酢酸エステル等のエステル系溶媒が挙げら れ、ジクロロメタン、クロロホルムが好ましい。反応温 度は-78℃から溶媒の沸点の範囲で行うことができ、室 温から溶媒の沸点の範囲で行うのが好ましい。

【0032】また、溶媒中で縮合剤および必要な場合に は塩基の存在下、化合物(IX)とカルボン酸(R^dC O2 H)を反応させることによっても配位子(XII) を得ることができる。用いられる縮合剤としては、1,3-カルボジイミド、N,N'-カルボニルジイミダゾール、ジ エチルアゾジカルボキシレート、2,4,6-トリニトロベン ゾイルクロリド、2,4,6-トリクロロベンゾイルクロリド 等が挙げられるが、2,4,6-トリクロロベンゾイルクロリ ドが好ましい。用いられる塩基としては、トリメチルア ミン、トリエチルアミン、ジイソプロピルアミン、N,N-ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、2,6-ルチジ ン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、4-ジメ チルアミノピリジン等のアミン類、トリブチルホスフィ アミノピリジンが好ましい。用いる溶媒は当該反応にお 50 ン、トリフェニルホスフィン等のホスフィン類が挙げら

れるが、これらの塩基は2種以上の組み合わせであって もよい。トリエチルアミン、4-ジメチルアミノビリジン が好ましい。用いる溶媒は当該反応において、不活性な ものであれば特に制限はないが、ペンタン、シクロペン タン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘブタン、シクロヘ プタン等の炭化水素系溶媒、ベンゼン、クロロベンゼ ン、ブロモベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族系 溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジ オキサン等のエーテル系溶媒、ジクロロメタン、クロロ ホルム、1,2-ジクロロエタン等の塩素系溶媒、アセトニ*10

29

*トリル、プロピオニトリル等のニトリル系溶媒、N,N-ジ メチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド等のア ミド系溶媒、酢酸メチル、酢酸エステル等のエステル系 溶媒が挙げられ、これらの溶媒は2種以上の組み合わせ であってもよく、テトラヒドロフラン、ジクロロメタ ン、トルエンが好ましい。反応温度は-78℃から溶媒の 沸点の範囲で行うことができ、室温から溶媒の沸点の範 囲で行うのが好ましい。

【0033】工程5 [化69]

$$(R^{e}C0)_{2}0$$

$$R^{e}H \qquad or$$

$$R^{e}C0X^{5} \qquad Fe$$

$$PR^{b}_{2} \qquad or$$

$$R^{e}C0_{2}H \qquad (X I V)$$

【0034】Qが次式 【化70】

で表される場合は、化合物(XIII)のアミノ基に通 常の保護基導入反応を行って配位子(XIV)を得ると とができる(工程5)。保護基導入反応は、例えば、文 献(T. W. Green, P. G. M. Wuts編, Protective Group 30 ピルカルボジイミド、N,N'-カルボニルジイミダゾー s in Organic Synthesis Third Edition, John Wiley & Sons, New York, 1999) に記載されている方法を適用 できる。すなわち、溶媒中、酸無水物((R°CO)2 O) または酸クロリド(R°COX°、X°はハロゲン 原子を示す。)を塩基の存在下、化合物(XIII)と 反応させることで、配位子(XIV)を得ることができ る。用いられる塩基としては、トリメチルアミン、トリ エチルアミン、ジイソプロピルアミン、N,N-ジイソプロ ピルエチルアミン、ピリジン、2,6-ルチジン、1,8-ジア ザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、4-ジメチルアミノビ 40 類が挙げられるが、これらの塩基は2種以上の組み合わ リジン等のアミン類が挙げられ、特にトリエチルアミ ン、4-ジメチルアミノビリジンが好ましく、これらの塩 基は2種以上の組み合わせであってもよい。用いる溶媒 は当該反応において、不活性なものであれば特に制限は ないが、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル系溶媒、ジクロロメタン、クロ ロホルム、1,2-ジクロロエタン等の塩素系溶媒、アセト ニトリル、プロピオニトリル等のニトリル系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド等の

系溶媒が挙げられ、ジクロロメタン、クロロホルムが好 ましい。反応温度は-78℃から溶媒の沸点の範囲で行う ことができ、室温から溶媒の沸点の範囲で行うのが好ま

【0035】また、溶媒中、縮合剤および必要な場合に は塩基の存在下、化合物(XIII)をカルボン酸(R °CO₂H)と反応させることによっても配位子(XI V)を得ることができる。用いられる縮合剤としては、 1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1,3-ジイソプロ ル、ジエチルアゾジカルボキシレート、2,4,6-トリニト ロベンゾイルクロリド、2,4,6-トリクロロベンゾイルク ロリド等が挙げられるが、特に2,4,6-トリクロロベンゾ イルクロリドが好ましい。用いられる塩基としては、ト リメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピルア ミン、N,N-ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、2, 6-ルチジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセ ン、4-ジメチルアミノピリジン等のアミン類、トリブチ ルホスフィン、トリフェニルホスフィン等のホスフィン せであってもよい。これらのうちではトリエチルアミ ン、4-ジメチルアミノビリジンが好ましい。用いる溶媒 は当該反応において、不活性なものであれば特に制限は ないが、ペンタン、シクロペンタン、ヘキサン、シクロ ヘキサン、ヘブタン、シクロヘブタン等の炭化水素系溶 媒、ベンゼン、クロロベンゼン、プロモベンゼン、トル エン、キシレン等の芳香族系溶媒、ジエチルエーテル、 テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエーテル系溶 媒、ジクロロメタン、クロロホルム、1.2-ジクロロエタ アミド系溶媒、酢酸メチル、酢酸エステル等のエステル 50 ン等の塩素系溶媒、アセトニトリル、プロピオニトリル

等のニトリル系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒、酢酸メチル、 酢酸エステル等のエステル系溶媒が挙げられ、これらの 溶媒は2種以上の組み合わせであってもよく、テトラヒ ドロフラン、ジクロロメタン、トルエンが好ましい。反 応温度は-78℃から溶媒の沸点の範囲で行うことがで き、特に室温から溶媒の沸点の範囲で行うのが好まし 61

【0036】本発明の製造方法に使用する第VIII族 遷移金属錯体は、次式

 $[ML_K Y_i]_m Z_n$

で表される。ことで、Mは第VIII族遷移金属を意味 し、そのうち、イリジウム、ロジウム、またはルテニウ ムが好ましく、イリジウムがさらに好ましい。しは有機 配位子を意味し、例えば、エチレン、アリル、ブタジエ ン、シクロヘキセン、1、3-シクロヘキサジェン、 1, 5-シクロオクタジエン、シクロオクタトリエン、 ノルボルナジエン、アクリル酸エステル、メタクリル酸 エステル、シクロペンタジエニル、ペンタメチルシクロ ペンタジエニル等が挙げられるが、1,5-シクロオク タジエンが好ましい。Yは水素原子、ハロゲン原子、カ ルボキシル基、アルコキシ基、またはヒドロキシ基を意 味し、これらのうちではハロゲン原子が好ましく、塩素 原子がさらに好ましい。乙はカウンターイオンを意味 し、例えば、BF4 - 、ClO4 - 、PFe - 、SOs CF。 等が挙げられる。第VIII族遷移金属錯体と しては、例えば、クロロ(ペンタメチルシクロペンタジ エニル) (1.5-シクロオクタジエン) ルテニウム (| | |)、クロロビス (エチレン) ロジウム (|) 二量 体、クロロ(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム (1)二量体、クロロ(ノルボルナジエン)ロジウム (1) 二量体、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ロ ジウム(1)テトラフルオロボレート、ビス(1,5-シクロオクタジエン) ロジウム(1) トリフルオロメタ ンスルホネート、クロロ(1,5-シクロオクタジエ ン) イリジウム(1) 二量体、クロロビス(シクロオク テン) イリジウム(1) 二量体、ビス(1,5-シクロ オクタジエン) イリジウム(1) テトラフルオロボレー ト等が挙げられるが、クロロ(1,5-シクロオクタジ エン)イリジウム(1)二量体が好ましい。

【0037】第VIII族遷移金属錯体の使用量は反応 基質や反応条件によって異なるが、反応基質である化合 物(1)に対するモル比で、1/1~1/100000程度を使用 して反応を遂行することができ、好ましくは1/10~1/10 0000程度の範囲である。

【0038】本発明の製造方法においては、第VIII 族遷移金属錯体[MLkY」]。 乙。のYと光学活性ホ スフィン配位子が置換して生成する錯体を触媒とする不 斉還元反応が進行する結果、光学活性なトリハロアニリ ノ誘導体を得るものと考えている。ことで、該触媒は反 50 として第VIII族遷移金属錯体と光学活性ホスフィン

応系中で生成させてもよく、また、あらかじめ調製した 触媒を反応系に投入してもよい。あらかじめ調製される 触媒としては、第VIII族遷移金属錯体 [ML

κ Y₁] _Z OYと光学活性ホスフィン配位子とを溶 液中で混合したもの、または、溶液から常法により単離 したものを用いることができる。さらに、反応系中で触 媒を生成させるために、第VIII族遷移金属錯体およ び光学活性ホスフィン配位子を反応系へ投入する際の順 序は特に限定されず、反応基質である化合物(Ⅰ)また 10 は化合物(I I)の投入前であると投入後であるとを問 わない。また、あらかじめ調製された触媒を反応系へ投 入する際の順序も特に限定されず、反応基質である化合 物(I)または化合物(II)の投入前であると投入後 であるとを問わない。

【0039】本発明の製造方法においては化学収率およ び不斉収率を向上させるため添加剤が用いられることが ある。添加剤としては、スクシンイミド、フタルイミ ド、α-メチル-α-プロピルスクシンイミド、2,3,3-ト リメチルスクシンイミド、マレイミド、シス-4-シクロ ヘキセン-1,2-ジカルボキシイミド、3,3-ジメチルグル タルイミド、1,8-ナフタルイミド、4,5-ジクロロフタル イミド、N-メチルフタルイミド、2,3-ナフタレンジカル ボキシイミド等のイミド類、よう化ナトリウム、よう化 カリウム、よう化テトラブチルアンモニウム、よう化ビ スマス(III)等のよう化化合物類、またはSiQ、AI ,O,、TiO、ZrO、等の金属酸化物類が挙げられる。

【0040】本発明の製造方法において用いる溶媒は還 元反応において、不活性なものであれば特に制限はない が、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロ 30 パノール等のアルコール系溶媒、ベンゼン、トルエン等 の芳香族系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ ン、1,4-ジオキサン等のエーテル系溶媒、ジクロロ メタン、クロロホルム等の塩素系溶媒、ヘキサン、シク ロヘキサン等の炭化水素系溶媒、酢酸メチル、酢酸エス テル等のエステル系溶媒、その他、酢酸、水等を用いる ことができる。これらの溶媒を2種以上混合して用いて もよいが、炭化水素系溶媒が好ましい。溶媒の使用量は 反応基質または配位子等の溶解度等により適宜決めると とができる。

【0041】本発明の製造方法における水素の圧力は、 40 通常、1~300kg/cm²程度の範囲で、特に1~ 100kg/cm²程度の範囲が好ましい。反応温度 は、通常、-78℃~溶媒の沸点の範囲で行うことがで きるが、好ましくは、-40~50℃の範囲である。反 応時間は反応基質濃度、触媒量、温度、水素圧等の反応 条件によって異なるが、通常は数分間から24時間程度 の範囲である。

[0042]

【発明の効果】本発明は、トリハロアニリンを出発物質

33

配位子を用いる還元反応により高収率で抗菌活性化合物 の有用な製造中間体である光学活性トリハロアニリノ誘 導体を製造できる方法である。また、光学活性配位子と して配位子(IVa)、配位子(IVb)、および配位 子(IVb')は、本発明の製造方法に適している。 [0043]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明を詳細に説明 するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではな 63.

【0044】 [実施例1] (S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジ フェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル エチルエー テル

【化71】

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エチルアセテート500 mq (0.78 mmol) をエタノー ル (25 mL) 中でマグネティックスターラーを用いて室 温で攪拌し、ここへナトリウムエトキシド80 mg(1.18 mmo7) を加えた。2.5 時間加熱還流下で反応させた後、 室温まで放置冷却した。反応液を桐山ロートを用いて吸 引濾過し、不溶物を除去した後、得られた母液を減圧下 溶媒留去した。得られた残渣をプレパラティブクロマト グラフィー (Merck社製、AluminiumOxide 60 Fz 54、20 て分離精製し、標題化合物を65 mg(収率13%)得た。 1 H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.56-7.11 (m, 20H), 4.64 (m, 1H), 4.47 (m,1H), 4.37 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 4.07 (m, 1H), 4.01 (m, 1H), 3.62 (m, 1H), 3.5 8 (m, 1H), 3.32 (m, 1H), 3.12 (m, 1H), 1.47 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 0.52 (t, 3 = 7.0 Hz, 3H).

【0045】[実施例2] ベンジル (S)-1-[(R)-1', 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルエ ーテル

【化72】

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エチルアセテート300 mg(0.47 mmol)をベンジル アルコール (3 mL) 中でマグネティックスターラーを用 50 いて室温で攪拌し、 ことヘビリジン1.00 mL (12.4 mmo 1) を加えた。100 ℃で8時間反応させた後、室温まで放 置冷却した。反応液ヘジエチルエーテル(8 mL)及び水 (4 mL)を加えた。反応液を分液ロートに移し、抽出操 作を行い、有機層を水(4 mL)で洗浄した。さらに有機 層を飽和食塩水(4 mL)で洗浄し、無水硫酸ナトリウム で乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣を、 アルミナカラムクロマトグラフィー(Merck社製、Alumi nium Oxide 90, 70-230 mesh、60 mL、n-ヘキサン: ジエチルエーテル = 10:1~5:1~2:1 → n-ヘキ サン: 酢酸エチル = 10:1) にて分離精製し、標題化 合物を180 mg (収率56%) 得た。

 $^{1}H-NMR$ (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.59-6.70 (m, 25H), 4.82 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.38 (m, 1H), 4.24 (d, J = 10.6 Hz, 1H), 4.19 (d, J = 10.6 Hz, 1H), 4.14(m, 1H), 4.08 (m, 1H), 3.95 (m, 1H), 3.71 (m, 1H), 3.54 (m, 1H), 1.55 (d, J = 5.1 Hz, 3H).【0046】[実施例3] (S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジ フェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ジフェニル 20 メチルエーテル

【化73】

80℃で融解させたベンズヒドロール (5 q) 中に、(S)-1 ×20 cm、n-ヘキサン : ジエチルエーテル = 4 : 1) に 30 -[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル] エチルアセテート 300 mg (0.47 mmol) を加え、マグネ ティックスターラーを用いて室温で攪拌し、ここヘビリ ジン1.00 mL (12.4 mmol) を加えた。ビリジンが加熱還 流する温度で7時間反応させた後、室温まで放置冷却し た。反応液へアルミナ(Merck社製、Aluminium Oxide 9 0,70230 mesh、20 g) を加えて減圧下溶媒留去した。 アルミナに吸着された残渣を、アルミナカラムクロマト グラフィー (Merck社製、Aluminium Oxide 90, 70230 m esh、80 mL、n-ヘキサン : ジエチルエーテル = 5 : 1 40 ~2:1 → n-ヘキサン:酢酸エチル = 10:1) にて 分離精製し、標題化合物を57 mg(収率16%)得た。 $^{1}H-NMR$ (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-6.94 (m, 30H), 5.23 (s, 1H), 4.64 (m,1H), 4.56 (m, 1H), 4.30 (m, 1H), 4.17 (m, 1H), 4.02 (m, 1H), 3.82 (m, 1H), 3.7 4 (m, 1H), 3.48 (m, 1H), 1.49 (d, J = 6.4 Hz, 3H).【0047】 [実施例4] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジ</u> フェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル t-ブチルジ メチルシリルエーテル

【化74】

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 500 mg (0.84 mmol) をジクロロメタ ン(5 mL)中でマグネティックスターラーを用いて室温 で攪拌し、ことへイミダゾール 256 mg (3.76 mmol) 及 10 びt-ブチルクロロジメチルシラン 453 mg(3.01 mmol) を加えた。加熱還流下で24.5時間攪拌した後、室温まで 放置冷却した。桐山ロートを用いた吸引濾過により反応 液中の不溶物を除去した。得られた母液を減圧下溶媒留 去し、残渣をアルミナカラムクロマトグラフィー(Merc k社製、Aluminium Oxide 90, 70-230 mesh、50 mL、n-ヘキサン : ジェチルエーテル = 10 : 1~5 : 1) にて 分離精製し、標題化合物を494mg(収率83%)得た。 1 H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-7.02 (m, 20H), 4.86 (m, 1H), 4.51 (m,1H), 4.43 (m, 1H), 4.11 (m, 2H), 3.93 (m, 1H), 3.59 (m, 1H), 3.50 (m, 1H), 1.5 5 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 0.73 (s, 9H), -0.07 (s, 3)H), -0.26 (s, 3H).

【0048】 [実施例5] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル メトキシメ</u>チルエーテル

【化75】

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エタノール 500 mg (0.84 mmol) をジクロロメタン (5 mL) 中でマグネティックスターラーを用いて室温で撹拌し、とこへN,N-ジイソプロビルエチルアミン437μL(2.51 mmol) 及びクロロメチルメチルエーテル152μL(2.00 mmol) を加えた。加熱還流下で3.5時間反 40 応させた後、氷浴を用いて反応液を0°Cまで冷却した。反応液へ飽和塩化アンモニウム水溶液 (5 mL) を加えた後、反応液を分液ロートに移し、抽出操作を行った。水層をジクロロメタン(2.5 mL) で再抽出した後、全ての有機層をあわせ、さらに水(5 mL) で洗浄した。さらに有機層を飽和食塩水(5 mL) で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣を、アルミナカラムクロマトグラフィー(Merck社製、Aluminium Oxide 90,70-230 mesh、50 mL、n-へキサン

チル = $10:1\sim5:1$) にて分離精製し、標題化合物を 29 mg (収率5%) 得た。

¹H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.56-7.07 (m, 20H), 4.84 (m, 1H), 4.48 (m,1H), 4.43 (d, J = 7.3 Hz, 1 H), 4.38 (m, 1H), 4.15 (m, 1H), 4.08 (m, 1H), 4.01 (m, 1H), 3.98 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 3.65 (m, 1H), 3.59 (m, 1H), 3.12 (s, 3H), 1.56 (d, J = 5.3 Hz, 3 H).

【0049】 [実施例6] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジ</u>フェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル プロビオネート 【化76】

20 (S)-N,N-ジメチル-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルアミン 500 mg (0.80 mmol) を無水プロビオン酸 (3 mL) 中で室温マグネティックスターラーを用いて攪拌し、その後100℃で3時間反応させた。反応液を0℃まで冷却した後、反応液へヘキサン (6 mL)を加えて、1時間攪拌した。反応液中に析出した固体を桐山ロートを用いた吸引濾過により取得した。この時、得た固体はヘキサン (4.5 mL)で桐山ロート上で洗浄した。減圧下室温で乾燥することで、標題化合物を201 mg (収率38.4%) 得た。

30 1 H-NMR (270 MHz, CDCl,) δ : 7.48-7.06 (m, 20H), 6.13 (m, 1H), 4.51 (m,1H), 4.45 (m, 1H), 4.17 (m, 1H), 4.13 (m, 1H), 4.10 (m, 1H), 3.63 (m, 1H), 1.5 7 (m, 1H), 1.49 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 1.17 (m, 1H), 0.68 (t, J = 7.5 Hz, 3H).

【0050】 [実施例7] (R)-1-[(S)-1',2-ピス(ジ フェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル イソブチレ ート

【化77】

有機層を飽和食塩水(5 mL)で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣 にか]エタノール 300 mg(0.50 mmol)をジクロロメタを、アルミナカラムクロマトグラフィー(Merck社製、A い(3 mL)中室温でマグネティックスターラーを用いて luminium Oxide 90, 70-230 mesh、50 mL、n-ヘキサン 提拌し、4-ジメチルアミノビリジン25 mg(0.20 mmol) まジエチルエーテル = 8:1 → n-ヘキサン:酢酸エ 50 及びトリエチルアミン314 μ L(2.25 mmol)を加え、さ

フェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ベンゾエー

【化79】

た。室温で17時間反応させた後、氷浴を用いて反応液を O°Cまで冷却した。反応液へ飽和塩化アンモニウム(3 m L) 及びジエチルエーテル (6 mL) を加えた。反応液を 分液ロートへ移し、分液操作を行い抽出した。有機層を 水(3 mL)で洗浄した後、さらに飽和食塩水(3 mL)で 洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、 減圧下溶媒留去した。得られた残渣をプレパラティブク ロマトグラフィー(Merck社製、Aluminium Oxide 60 F 254、20×20 cm、n-ヘキサン : ジエチルエーテル = 5 : 1) にて分離精製し、標題化合物を164 mg(収率49 %) 得た。

 $^{1}H-NMR$ (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.50-7.04 (m, 20H), 6.10 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.44 (m, 1H), 4.18 (m, 1H), 4.12 (m, 1H), 4.04 (m, 1H), 3.66 (m, 1H), 3.6 0 (m, 1H), 1.55 (m, 1H), 1.47 (d, J = 6.4 Hz, 3H),0.80 (d, J = 7.1 Hz, 3H), 0.61 (d, J = 6.8 Hz, 3 H).

【0051】[実施例8] (R)-1-[(S)-1',2-ビス(ジ <u>フェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ピバレート</u> 20 操作を行い抽出した。有機層を水(5 mL)で洗浄した [化78]

(R)-1-[(S)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 300 mg(0.50 mmol) をジクロロメタ ン (3 mL) 中室温でマグネティックスターラーを用いて 攪拌し、4-ジメチルアミノピリジン12 mg(98.2 μ mol) 及びトリエチルアミン210μL (1.51 mmol) を 加え、さらにトリメチルアセチルクロリド148µL(1.2 0 mmo1) を加えた。室温で25時間反応させた後、氷浴を 用いて反応液を0℃まで冷却した。反応液へ飽和塩化ア ンモニウム (5 mL) 及びジクロロメタン (5 mL) を加え た。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い抽出し た。有機層を水(5 mL)で洗浄した後、さらに飽和食塩 水(5 mL)で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで 40 乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣をプレ パラティブクロマトグラフィー(Merck社製、Aluminium Oxide 60 F_{2,4}、20×20 cm、n-ヘキサン : ジエチルエ ーテル = 4:1) にて分離精製し、標題化合物を45 mg (収率13%)得た。

 $^{1}H-NMR$ (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-7.02 (m, 20H), 6.07 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.41 (m, 1H), 4.20 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.91 (m, 1H), 3.75 (m, 1H), 3.5 1 (m, 1H), 1.46 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 0.76 (s, 9H). 【0052】 [実施例9] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジ</u>

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 500 mg(0.84 mmol)をジクロロメタ ン(5 mL)中室温でマグネティックスターラーを用いて 攪拌し、4-ジメチルアミノピリジン20 mg (0.16 mmol) 及びトリエチルアミン349μL(2.50 mmol)を加え、さ らにベンゾイルクロリド233μL (2.01 mmol) を加え た。室温で3時間反応させた後、氷浴を用いて反応液を0 ℃まで冷却した。反応液へ水(5 mL)及びジクロロメタ ン(5 mL)を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液 後、さらに飽和食塩水(5 mL)で洗浄した。有機層を無 水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。 得られた残渣をアルミナカラムクロマトグラフィー (Me rck社製、Aluminium Oxide 90, 70-230 mesh、70 mL、 n-ヘキサン : ジエチルエーテル = 10 : 1~5 : 1 → n -ヘキサン : 酢酸エチル = 20 : 1~10 : 1~5 :1) に て分離精製し、標題化合物を159 mg(収率26%)得た。 $^{1}H-NMR$ (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.55-6.85 (m, 25H), 6.36 (m, 1H), 4.58 (m, 1H), 4.48 (m, 1H), 4.20 (m, 30 1H), 4.16 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.67 (m, 2H), 1.6 0 (d, J = 6.5 Hz, 3H).

【0053】 [実施例10] (R)-1-[(S)-1',2-ビス (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル シクロ プロパンカルボキシレート

【化80】

(R)-1-[(S)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 125 mg (0.21 mmol) をジクロロメタ ン (2 mL) 中室温でマグネティックスターラーを用いて 攪拌し、4-ジメチルアミノピリジン13 mg(0.11 mmol) 及びトリエチルアミン73μL(0.52 mmol)を加え、さ **らにシクロプロパンカルボニルクロリド38μL(0.42 m** mol)を加えた。室温で2.5時間反応させた後、氷浴を用 50 いて反応液を0℃まで冷却した。反応液へ飽和塩化アン

モニウム水溶液 (4 mL) 及びジエチルエーテル (8 mL) を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い 抽出した。有機層を水(4 mL)で洗浄した後、さらに飽 和食塩水 (2 mL) で洗浄した。得られた有機層に、無水 硫酸ナトリウム (1 g)、フロリジール (U.S. SILICACO MPANY、60-100 mesh、500 mg) 及びアルミナ (Merck社 製、Aluminium Oxide90, 70-230 mesh、500 mg) を加 えて、室温で1時間攪拌した。その後、桐山ロートを用 いた吸引濾過により、不溶物を除去した。得られた母液 を減圧下溶媒留去し、標題化合物を137 mg(収率99%) 得た。

 $^{1}H-NMR$ (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.50-7.06 (m, 20H), 6.10 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.44 (m, 1H), 4.17 (m, 1H), 4.13 (m, 1H), 4.08 (m, 1H), 3.63 (m, 1H), 1.4 9 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.78-0.37 (m, 4H), 0.20(m, 1H).

【0054】[実施例11] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス</u> (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル シクロ ペンタンカルボキシレート

【化81】

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 125 mq (0.21 mmol) をジクロロメタ ン(2 mL)中室温でマグネティックスターラーを用いて 30 攪拌し、4-ジメチルアミノピリジン13 mg(0.11 mmol) 及びトリエチルアミン73μL(0.52 mmo1)を加え、さ らにシクロペンタンカルボニルクロリド51μL(0.42 m mol) を加えた。室温で3.5時間反応させた後、氷浴を用 いて反応液を0℃まで冷却した。反応液へ飽和塩化アン モニウム水溶液 (4 mL) 及びジエチルエーテル (8 mL) を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い 抽出した。有機層を水(4 mL)で洗浄した後、さらに飽 和食塩水(4 mL)で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリ ウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣 40 をプレパラティブクロマトグラフィー(Merck社製、Alu minium Oxide 60 Fzs4、20×20 cm、n-ヘキサン : 酢酸 エチル = 6:1) にて分離精製し、標題化合物を91 mg (収率63%) 得た。

¹H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-7.02 (m, 20H), 6.09 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.43 (m, 1H), 4.18 (m, 1H), 4.12 (m, 1H), 4.03 (m, 1H), 3.66 (m, 1H), 3.6 0 (m, 1H), 1.78-1.04 (m, 9H), 1.48 (d, J = 6.4 H)z, 3H).

【0055】[実施例12] <u>(R)-1-[(S)-1',2-ビス</u>

(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル シクロ ヘキ<u>サンカルボキシレート</u>

【化82】

(R)-1-[(S)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 125 mg (0.21 mmol) をジクロロメタ ン(2 mL)中室温でマグネティックスターラーを用いて 攪拌し、4-ジメチルアミノピリジン13 mg (0.11 mmol) 及びトリエチルアミン146μL(1.05 mmol)を加え、さ らにシクロヘキサンカルボニルクロリド112μL(0.84 mmo1)を加えた。室温で4時間反応させた後、氷浴を用 いて反応液を0℃まで冷却した。反応液へ飽和塩化アン モニウム水溶液 (4 mL) 及びジエチルエーテル (8 mL) 20 を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い 抽出した。有機層を水(4 mL)で洗浄した後、さらに飽 和食塩水(2 mL)で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリ ウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣 をブレパラティブクロマトグラフィー(Merck社製、Alu minium Oxide 60 F254、20×20 cm、n-ヘキサン: 酢酸 エチル = 6:1) にて分離精製し、標題化合物を27 mg (収率18%) 得た。

 1 H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.50-7.04 (m, 20H), 6.08 (m, 1H), 4.51 (m,1H), 4.44 (m, 1H), 4.18 (m, 1H), 4.12 (m, 1H), 4.04 (m, 1H), 3.65 (m, 1H), 3.6 0 (m, 1H), 1.56-0.74 (m, 11H), 1.47 (d, J = 6.3 H z, 3H).

【0056】[実施例13] (S)-1-[(R)-1',2-ビス (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ジシク ロヘキシルアセテート

【化83】

ジシクロヘキシル酢酸 140 mq (0.62 mmol) のテトラヒ ドロフラン (1 mL) 中室温でマグネティックスターラー を用いて攪拌し、ここヘトリエチルアミン96μL (0.69 mmo1)を加えて5分間攪拌した。続いて2,4,6-トリクロ ロベンゾイルクロリド108μL (0.69 mmol) を加え、30 分間攪拌した。この反応液へ、(S)-1-[(R)-1',2-ビス 50 (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エタノール 125

mg (0.21 mmol) のトルエン (4 mL) 溶液及び4-ジメチルアミノビリジン 102 mg (0.83 mmol) を加えた。70°Cで19時間反応させた後、反応液を0°Cまで冷却し、飽和塩化アンモニウム水溶液 (4 mL) 及びジエチルエーテル (10 mL) を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い抽出した。有機層を水 (4 mL) で洗浄した後、さらに飽和食塩水 (2 mL) で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣をプレパラティブクロマトグラフィー(Merck社製、Aluminium Oxide 60 F2:1、20×20 cm、n-へキサン:酢酸エチル= 10:1) にて分離精製し、標題化合物を121 mg (収率72%) 得た。

¹H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.57-6.91 (m, 20H), 5.95 (m, 1H), 4.53 (m,1H), 4.37 (m, 1H), 4.18 (m, 1H), 4.10 (m, 1H), 3.84 (m, 1H), 3.72 (m, 1H), 3.44 (m, 1H), 1.85-0.74 (m, 23H), 1.58 (d, J = 6.3 Hz. 3H).

【0057】[実施例14] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス</u> (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ジフェ ニルアセテート

[化84]

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 125 mg(0.21 mmol)をジクロロメタ ン(2 mL)中0 ℃でマグネティックスターラーを用いて 攪拌し、4-ジメチルアミノピリジン5 mg(40.9μmol) 及びトリエチルアミン44μL(0.32 mmol)を加え、さ らにジフェニルアセチルクロリド 72 mg(0.31 mmol) を加えた。室温で3.5時間反応させた後、氷浴を用いて 反応液を0℃まで冷却した。反応液へ飽和塩化アンモニ ウム水溶液(4 mL)及びジエチルエーテル(8 mL)を加 えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い抽出 した。有機層を水(4 mL)で洗浄した後、さらに飽和食 塩水 (2 mL) で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウム 40 で乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた有機層 に、無水硫酸ナトリウム(1g)、フロリジール(U.S. SILICA COMPANY、60-100 mesh、1 g) 及びアルミナ (M erck社製、Aluminium Oxide 90, 70-230 mesh、1 g) を加えて、室温で1時間攪拌した。その後、桐山ロート を用いた吸引濾過により、不溶物を除去した。得られた 母液を減圧下溶媒留去し、標題化合物を167 mg(収率定 量的) 得た。

 1 H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-7.00 (m, 28H), 6.74 (m, 2H), 6.13 (m,1H), 4.44 (m, 1H), 4.38 (m,

1H), 4.15 (m, 1H), 4.09 (m, 1H), 3.97 (m, 2H), 3.6 4 (m, 1H), 3.55 (m, 1H), 1.45 (d, J = 6.3 Hz, 3H). 【0058】[実施例15] (S)-1-[(R)-1',2-ビス (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル アダマ ンタンカルボキシレート

[化85]

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセ ニル]エタノール 150 mg (0.25 mmol) をジクロロメタ ン (2 mL) 中室温でマグネティックスターラーを用いて 攪拌し、4-ジメチルアミノピリジン61 mg (0.50 mmol) 及びトリエチルアミン70μL(0.50 mmol)を加え、さ らに1-アダマンタンカルボニルクロリド75mg(0.38 mmo 20 1) を加えた。室温で1時間反応させた後、氷浴を用いて 反応液を0℃まで冷却した。反応液へ飽和塩化アンモニ ウム水溶液 (5 mL) 及びジエチルエーテル (10 mL) を 加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い抽 出した。有機層を水(5 mL)で洗浄した後、さらに飽和 食塩水(2.5 mL)で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリ ウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣 をプレパラティブクロマトグラフィー(Merck社製、Alu minium Oxide 60 Fzs4、20×20 cm、n-ヘキサン : 酢酸 エチル = 8:1) にて分離精製し、標題化合物を163 mg (収率85%) 得た。

¹H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-7.35 (m, 20H), 6.07 (m, 1H), 4.53 (m,1H), 4.41 (m, 1H), 4.20 (m, 1H), 4.10 (m, 1H), 3.91 (m, 1H), 3.75 (m, 1H), 3.4 9 (m, 1H), 1.72 (m, 3H), 1.57-1.33 (m, 12H), 1.45 (d, J = 6.3 Hz, 3H).

【0059】 [実施例16] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス</u> (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ジ-n-ブ ロビルアセテート

[化86]

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エタノール 125 mg (0.21 mmol) をジクロロメタン (2 mL) 中室温でマグネティックスターラーを用いて50 撹拌し、4-ジメチルアミノピリジン13 mg (0.11 mmol)

及びトリエチルアミン146μL (1.05 mmol) を加え、さらに2-n-プロピル-n-吉草酸クロリド153 mg (0.94 mmol) を加えた。室温で7時間反応させた後、氷浴を用いて反応液を0°Cまで冷却した。反応液へ飽和塩化アンモニウム水溶液 (4 mL) 及びジエチルエーテル (8 mL) を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い抽出した。有機層を水 (4 mL) で洗浄した後、さらに飽和食塩水 (2 mL) で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣をプレバラティブクロマトグラフィー (Merck社製、Alumini 10 um Oxide 60 F2:14、20×20 cm、n-ヘキサン : 酢酸エチル = 10 : 1) にて分離精製し、標題化合物を63mg (収率42%) 得た。

43

¹H- NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-6.96 (m, 20H), 6.06 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.40 (m, 1H), 4.19 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.92 (m, 1H), 3.70 (m, 1H), 3.5 0 (m, 1H), 1.59 (m, 1H), 1.50 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 1.30-0.70 (m,8H), 0.76 (t, J = 7.0 Hz, 3H), 0.63 (t, J = 7.1 Hz, 3H).

【0060】 [実施例17] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス</u> (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ジ-n-デ シルアセテート

[{ 4 8 7]

2-デシルドデカン酸 128 mg (0.38 mmol) のテトラヒド ロフラン(0.5 mL)中室温でマグネティックスターラー を用いて攪拌し、ことヘトリエチルアミン57μL(0.41 mmo1) を加えて5分間攪拌した。続いて2,4,6-トリクロ ロベンゾイルクロリド64µL(0.41 mmol)を加え、30 分間攪拌した。この反応液をトルエン(1 mL)で希釈し た後、(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フ ェロセニル]エタノール 150 mg (0.25 mmol) のトルエ ン(2 mL)溶液を室温でマグネティックスターラーを用 いて攪拌しているところへ加えた。続いて4-ジメチルア ミノピリジン 61 mg (0.50 mmol) を加えてから、50℃ で1時間反応させた後、反応液を0℃まで冷却し、飽和塩 化アンモニウム水溶液 (5 mL) 及びジエチルエーテル (10 mL)を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液 操作を行い抽出した。有機層を水 (5 mL) で洗浄した 後、さらに飽和食塩水(2.5 mL)で洗浄した。有機層を 無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去し た。得られた残渣をプレパラティブクロマトグラフィー (Merck社製、Aluminium Oxide 60 F₂,4、20×20 cm、n -ヘキサン : 酢酸エチル = 10 : 1) にて分離精製し、

標題化合物を168 mg (収率73%) 得た。

¹H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.54-6.96 (m, 20H), 6.05 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.40 (m, 1H), 4.18 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.92 (m, 1H), 3.68 (m, 1H), 3.5 0 (m, 1H), 1.54 (m, 1H), 1.50 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 1.37-0.93 (m,36H), 0.89 (t, J = 6.7 Hz, 3H), 0.8 7 (t, J = 6.7 Hz, 3H).

【0061】 [実施例18] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス</u> (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル ジ-n-テトラデシルアセテート

[化88]

2-テトラデシルヘキサデカン酸 170 mg (0.38 mmol) の 20 テトラヒドロフラン (1mL) 中室温でマグネティックス ターラーを用いて攪拌し、ここへトリエチルアミン57μ L (0.41 mmol) を加えて5分間攪拌した。続いて2,4,6-トリクロロベンゾイルクロリド64μL(0.41 mmol)を 加え、30分間攪拌した。この反応液をトルエン(2 mL) で希釈した後、(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホス フィノ)フェロセニル]エタノール 150 mg (0.25 mmol) のトルエン (2 mL) 溶液を室温でマグネティックスター ラーを用いて攪拌しているところへ加えた。続いて4-ジ メチルアミノピリジン 61 mg(0.50 mmol)を加えてか 30 ら、50℃で0.5時間反応させた後、反応液を0℃まで冷却 し、飽和塩化アンモニウム水溶液(5 mL)及びジエチル エーテル (10 mL) を加えた。 反応液を分液ロートへ移 し、分液操作を行い抽出した。有機層を水(5 mL)で洗 浄した後、さらに飽和食塩水(2.5 mL)で洗浄した。有 機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留 去した。得られた残渣をプレパラティブクロマトグラフ ィー (Merck社製、Aluminium Oxide 60Fzs4、20×20 c m n-ヘキサン : 酢酸エチル = 15 : 1) にて分離精製 し、標題化合物を204 mg(収率79%) 得た。

40 1 H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.54-6.94 (m, 20H), 6.05 (m, 1H), 4.53 (m,1H), 4.39 (m, 1H), 4.18 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.92 (m, 1H), 3.69 (m, 1H), 3.5 0 (m, 1H), 1.56 (m, 1H), 1.50 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 1.37-0.81 (m,58H).

【0062】 [実施例19] <u>(S)-1-[(R)-1',2-ビス</u> (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル 2, 2 -ジメチルヘキサノエート

【化89】

50

2.2-ジメチルヘキサン酸 108 mg (0.75 mmol) のテトラ ヒドロフラン (1 mL) 中室温でマグネティックスターラ ーを用いて攪拌し、ととヘトリエチルアミン114µL (0.82 mmol)を加えて5分間攪拌した。続いて2,4,6-ト リクロロベンゾイルクロリド128μL (0.82 mmol) を加 え、30分間攪拌した。この反応液をトルエン(2 mL)で 希釈した後、(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフ ィノ)フェロセニル]エタノール 150 mg (0.25 mmol) の トルエン (2 mL) 溶液を室温でマグネティックスターラ ーを用いて攪拌しているところへ加えた。続いて4-ジメ チルアミノピリジン 122 mg (1.00 mmol) を加えてか ら、80℃で20.5時間反応させた後、反応液を0℃まで冷 却し、飽和塩化アンモニウム水溶液(10 mL)及びジエ チルエーテル(10 mL)を加えた。反応液を分液ロート へ移し、分液操作を行い抽出した。有機層を水(10 m L) で洗浄した後、さらに飽和食塩水 (5 mL) で洗浄し た。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下 溶媒留去した。得られた残渣をプレバラティブクロマト グラフィー (Merck社製、Aluminium Oxide 60 Fzs4、20 ×20 cm、n-ヘキサン : 酢酸エチル = 10 : 1で展開し た後、n-ヘキサン: ジエチルエーテル = 5 : 1で展開) にて分離精製し、標題化合物を88 mg(収率48%)得た。 $^{1}H-NMR$ (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-7.00 (m, 20H), 6.05 (m, 1H), 4.53 (m,1H), 4.40 (m, 1H), 4.20 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.89 (m, 1H), 3.75 (m, 1H), 3.4 9 (m, 1H), 1.47 (d, J = 6.3 Hz, 3H), 1.35-0.89(m, 6H), 0.81 (t,J = 7.3 Hz, 3H), 0.71 (s, 3H), 0. 68 (s, 3H).

【0063】[実施例20] (S)-1-[(R)-1',2-ビス (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル シクロ ウンデカンカルボキシレート

[化90]

シクロウンデカン酸 75 mg (0.38 mmol) のテトラヒド ロフラン (0.5 mL) 中室温でマグネティックスターラー を用いて攪拌し、ととヘトリエチルアミン57μL(0. ロロベンゾイルクロリド64µL (0.41 mmol)を加え、3 0分間攪拌した。この反応液をトルエン(2mL)で希釈し た後、(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フ ェロセニル]エタノール 150 mg (0.25 mmol) のトルエ ン(2 mL)溶液を室温でマグネティックスターラーを用 いて攪拌しているところへ加えた。続いて4-ジメチルア ミノピリジン 61 mg (0.50 mmol) を加えてから、50℃ で0.5時間反応させた後、反応液を0℃まで冷却し、飽和 塩化アンモニウム水溶液 (5 mL) 及びジエチルエーテル (10 mL)を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液 操作を行い抽出した。有機層を水(5 mL)で洗浄した 後、さらに飽和食塩水(2.5 mL)で洗浄した。有機層を 無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去し た。得られた残渣をプレパラティブクロマトグラフィー (Merck社製、Aluminium Oxide 60 F2:4、20×20 cm、n -ヘキサン : 酢酸エチル = 10 : 1) にて分離精製し、 標題化合物を146 mg (収率76%) 得た。

 1 H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.52-7.37 (m, 20H), 6.09 (m, 1H), 4.52 (m,1H), 4.42 (m, 1H), 4.18 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.98 (m, 1H), 3.67 (m, 1H), 3.5 5 (m, 1H), 1.58 (m, 1H), 1.46 (d, J = 6.4 Hz, 3H),1.43 - 0.93 (m, 20H).

【0064】 [実施例21] (S)-1-[(R)-1',2-ビス (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチル 2,3,5, 6,8,9,11,12,14,15-デカヒドロ-1,4,7,10,13,16-ベンゾ ヘキサオキサシクロオクタデシン-18-カルボキシレート 【化91】

4-カルボキシベンゾ-18-クラウン-6 179 mg (0.50 mmo 1) のテトラヒドロフラン (2 mL) 中室温でマグネティ 40 ックスターラーを用いて攪拌し、ここへトリエチルアミ ン76μL (0.55 mmol) を加えて5分間攪拌した。続いて 2,4,6-トリクロロベンゾイルクロリド85μL (0.54 mmo 1)を加え、30分間攪拌した。この反応液をトルエン(2 mL) で希釈した後、(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニル ホスフィノ)フェロセニル]エタノール 200 mg (0.33 mm ol) のトルエン (4 mL) 溶液を室温でマグネティックス ターラーを用いて攪拌しているところへ加えた。続いて 4-ジメチルアミノビリジン 81 mg (0.66 mmol) を加え てから、50℃で3時間反応させた後、反応液を0℃まで冷 41 mmol)を加えて5分間攪拌した。続いて2,4,6-トリク 50 却し、水(5 mL)及びトルエン(10 mL)を加えた。反

応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い抽出した。有機層を飽和食塩水(5 mL)で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣をプレパラティブクロマトグラフィー(Merck社製、Aluminium Oxide 60 $F_{2,54}$ 、 20×20 cm、n-ヘキサン:酢酸エチル = 1:3.5)にて分離精製し、標題化合物を206 mg(収率66%)得た。

 $^{1}H-NMR~(270~MHz,~CDCl_{3})~\delta:7.48-6.85~(m,~22H),\\ 6.57~(m,~1H),~6.30~(m,1H),~4.56~(m,~1H),~4.47~(m,~1H),~4.22-4.04~(m,~7H),~3.96-3.85~(m,~4H),~3.81\\ -3.63~(m,~14H),~1.55~(d,~J=6.4~Hz,~3H).$

【0065】[実施例22] <u>(S)-N-1-[(R)-1',2-ビス</u> (ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルアセトア ミド

【化92】

(S)-1-[(R)-1',2-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルアミン 125mg (0.21 mmol) をジクロロメタン (2 mL) 中室温でマグネティックスターラーを用いて攪拌し、4-ジメチルアミノビリジン5 mg (40.9 μ m o l) 及びトリエチルアミン41 μ L (0.29 mmol) を加えた。0°Cで15分間反応させた後、反応液へ水 (2 mL) 及びジクロロメタン (8 mL)を加えた。反応液を分液ロートへ移し、分液操作を行い抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下溶媒留去した。得られた残渣をプレパラティブクロマトグラフィー(Merck 社製、Aluminium Oxide 60 $F_{2,3,4}$ 、20×20 cm、n-ヘキサン:酢酸エチル = 1:2)にて分離精製し、標題化合物を120 mg (収率90%) 得た。

 1 H-NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 7.46-7.11 (m, 20H), 5.47 (m, 1H), 5.12 (m,1H), 4.47 (m, 1H), 4.42 (m,

 1H), 4.26-4.07 (m, 3H), 3.58 (m, 1H), 3.56(m, 1H), 1.32 (d, J = 7.3 Hz, 3H), 1.30 (s, 3H).

 [0066] [実施例23]

フルオロアニリノ) - プロパノール クロロー1,5-シクロオクダジエンイリジウム(1) 二量体1. 3 mg (1. 94 μ m o l) 及び光学活性リ ガンドとして、化合物(2-11)3.0mg(4.1 4μmol)を、シクロペンタン(4mL)中で室温で マグネティックスターラーを用いて1時間攪拌した。と 10 Cへ、2, 3, 4-トリフルオロアニリン20. 0μL (0.19 mmol) 及びヒドロキシアセトン20.0 μ L(0.29mmol)を順次加えた。反応液をオートクレ ーブに移した後、5 kg/cm2の水素で3回、オート クレーブ内を置換した後、50kg/cm²の水素によ り加圧した。0℃で18時間攪拌した。最終反応液に含 まれる標題化合物の化学収率は高速液体クロマトグラフ ィー (カラム: YMC-Pack SIL·S-5μm ・60A・YMC社製、溶出溶媒: ヘキサン: 酢酸エチ ル=70:30)により、また不斉収率は高速液体クロ 20 マトグラフィー (カラム: DAICEL CHIRAL PAK OD・ダイセル化学工業社製、溶出溶媒: ヘキ サン:イソプロパノール=95:5) により測定した結 果、定量的、76%ee(S体)であった。なお、別途 反応を実施し、反応液を減圧下溶媒留去した後、得られ た残渣をプレパラティブクロマトグラフィー(Merck社 製、Silica gel 60 F254、20×20 cm、n-ヘキサン:酢 酸エチル = 2 : 1) にて分離精製し、1H NMRを測定し た。

 1 H- NMR (270 MHz, CDCl₃) δ : 6.81 (m, 1H), 6.43 30 (m, 1H), 3.81- 3.48 (m, 4H), 1.84 (br s, 1H), 1.22 (d, J = 5.9 Hz, 3H).

【0067】他の光学活性配位子に関する実施例については、以下の表1および表2に示す。表1および表2において、化合物(III)は特に標記のない限りS体、すなわち化合物(IIIa)である。

[0068]

【表1】

7.7					,
実施例	光学活性\$スフィン配位子	反応 温度 (℃)	反応 時間 (h)	化合物 (化学 収率 (%)	III) 不斉 収率 (e e %)
2 4	DIOP	4 0	17	4 6	4 0
2 5	MOD-DIOP	4 0	17	7	5 B (R)
26	BPPM	4 0	17	19	39 (R)
27	BDPP	40	18	6	6 9
28	врргон	2 0	18	63	2 8
2 9	BPPFOAc	20	18	9 5	5 4
30	配位子 (1-1)	20	18	9 5	4 2
3 1	配位子 (1-2)	20	18	9 5	3 2
3 2	配位子 (1-4)	2 0	18	9 3	1 6
3 3	配位子 (1-5)	20	18	9 4	3 3
3 4	配位子 (2-1)	20	18	9 0	5 6
35	配位子 (2-2)	20	18	9 6	66 (R)
36	配位子 (2-3)	20	18	9 3	67 (R)
3 7	配位子 (2-4)	20	18	9 6	5 3

[0069]

* *【表2】

	Y			1	
実施例	光学活性#2742配位子	反応 温度 (*C)	反応 時間 (h)	化合物 化学 収率 (%)	(III) 不斉 収率 (ee%)
38	配位子 (2-5)	20	18	定量的	66 (R)
3 9	配位子(2-6)	20	18	9 7	64
4 0	配位子 (2-7)	2 0	18	9 7	68 (R)
4 1	配位子(2-8)	20	18	9 6	59
4 2	配位子 (2-9)	20	18	9 6	67
4 3	配位子(2-10)	-10	18	定量的	7 1
4 4	配位子 (2-11)	20	18	9 6	70
4 5	配位子 (2-12)	20	18	定量的	70
4 6	配位子 (2-13)	-10	18	定量的	73
47	配位子(2-14)	20	18	9 4	70
4 8	配位子 (2-15)	-10	18	98	6 9
4 9	配位子 (2-16)	20	18	9 3	46
50	配位子 (3-1)	20	18	8 9	29

・ ''' , フロントページの続き

(51) Int .Cl .'		識別記号	FI		テーマコード(参考)
// C07B	53/00		C 0 7 B	53/00	В
	61/00	300		61/00	300
C 0 7 F	9/50		C 0 7 F	9/50	
	17/02			17/02	
C 0 7 M	7:00		C 0 7 M	7:00	

Fターム(参考) 4C022 NA04

4G069 AA06 AA08 BA27A BA27B
BA27C BC65A BC65B BC65C
BC66B BC69A BC69C BC74B
BE14A BE14B BE14C BE26A
BE26B BE26C BE32A BE32B
BE32C BE33C BE36A BE36B
BE36C CB57 DA02 FAU1
FB77 FC02

4H006 AA02 AC81 BA19 BA22 BA23
BA48

4H039 CA71 CB40 CF30

4H039 CA71 CB40 CF30 4H050 AA01 AA03 AB40 AC40 AC50 WB11